

474919-2026 - Mise en concurrence

Pays-Bas – Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) –
European Tender Electron Beam Lithography system

OJ S 130/2026 09/07/2026

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement

Fournitures

1. Acheteur

1.1. Acheteur

Nom officiel: Universiteit Twente

Adresse électronique: c.delfgaauw@utwente.nl

Forme juridique de l'acheteur: Entreprise publique

Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

2. Procédure

2.1. Procédure

Titre: European Tender Electron Beam Lithography system

Description: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identifiant de la procédure: d75e7f85-f950-4008-ab95-b4ee18bf06fa

Identifiant interne: 379fcf7e-45c5-4d48-b8ea-3be831450e85

Type de procédure: Ouverte

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

Nomenclature complémentaire (cpv): 38341100 Enregistreurs à faisceaux d'électrons

2.1.2. Lieu d'exécution

Pays: Pays-Bas

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires: Zie documentatie

2.1.3. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 500 000,00 EUR

2.1.4. Informations générales

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

2.1.6. Motifs d'exclusion

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0000

Titre: European Tender Electron Beam Lithography system

Description: The University of Twente is tendering to purchase an Electron Beam Lithography system. The MESA+ Institute of the University of Twente will invest in a new Electron Beam system (e-beam system). A system, suitable for defining patterns in electron sensitive resists, at high resolution and high speed, compatible with a wide range of applications and substrate types up to 200mm in diameter. The system will be used by a wide range of users, i.e. academic researchers and students as well as industrial engineers with different backgrounds (photonics, (nano)-electronics etc.) and different levels of expertise.

Identifiant interne: 0b4a476d-7047-4e2b-907c-d85c9f9859e4

5.1.1. Objet

Nature principale du marché: Fournitures

Nomenclature principale (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

Nomenclature complémentaire (cpv): 38341100 Enregistreurs à faisceaux d'électrons

5.1.2. Lieu d'exécution

Pays: Pays-Bas

N'importe où dans le pays donné

Informations complémentaires: Zie documentatie

5.1.3. Durée estimée

Autre durée: Inconnu

5.1.5. Valeur

Valeur estimée hors TVA: 3 500 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales

Participation réservée:

La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l'UE

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Document de marché, Document unique de marché européen (DUME)

5.1.11. Documents de marché

Adresse des documents de marché: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

5.1.12. Conditions du marché public

Conditions de soumission:

Soumission par voie électronique: Autorisée

Adresse de soumission: <https://s2c.mercell.com/today/217278>

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais

Catalogue électronique: Non autorisée

Date limite de réception des offres: 21/08/2026 10:00:00 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Durée de validité des offres: 90 Jours

Conditions du marché:

Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d'emplois protégés: Non

Facturation électronique: Autorisée

La commande en ligne sera utilisée: non

Le paiement électronique sera utilisé: oui

5.1.15. Techniques

Accord-cadre:

Pas d'accord-cadre

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours

Organisation chargée des procédures de recours: Rechtbank Overijssel

Description des délais d'introduction des procédures de recours: See descriptive document.

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours: Universiteit Twente

8. Organisations

8.1. ORG-0001

Nom officiel: Universiteit Twente

Numéro d'enregistrement: 50130536

Adresse postale: Drienerlolaan 5

Ville: Enschede

Code postal: 7522NB

Subdivision pays (NUTS): Twente (NL213)

Pays: Pays-Bas

Point de contact: Camilio Delfgaauw

Adresse électronique: c.delfgaauw@utwente.nl

Téléphone: +31534891512

Adresse internet: <https://www.utwente.nl>

Profil de l'acheteur: <https://s2c.mercell.com/buyer/16033>

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

8.1. ORG-0002

Nom officiel: Rechtbank Overijssel

Numéro d'enregistrement: 82940525

Ville: Almelo

Code postal: 7607 GB

Subdivision pays (NUTS): Twente (NL213)

Pays: Pays-Bas

Adresse électronique: communicatie.rb-ove@rechtspraak.nl

Téléphone: (+31)0883611042

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours

10. Changement

Version de l'avis antérieur à modifier

:

d8072cd8-e497-49af-b432-8865f10c18de-01

Principale raison du changement

:

Correction par l'acheteur

Description

:

Recently, the University of Twente has started a tender-procedure for the purchase of an electron beam lithography system (T217278 European Tender Electron Beam Lithography system). Unfortunately, we have realized that the Descriptive Document contained several (minor) short-comings. More specific, in the revised Descriptive Document a time-slot for site-inspection is included, as well as a correct textual description of the weighting of the three award criteria is inserted at the end of section 4.2 (viz. 70% (wishes; G1), 10% (sustainability; G2) and 20% (price; G3)). In appendix B Schedule of Requirements and Wishes – the subsection regarding '(extended) warranty' has been removed (table P) and added to the maintenance subsection (see item O.2 in table O).

10.1. Changement

Identifiant de la section: LOT-0000

Les documents de marché ont été modifiés le: 08/07/2026

Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis: d3fc913d-812e-4d95-a132-8a6de8b80aa4 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

Sous-type d'avis: 16

Date d'envoi de l'avis: 08/07/2026 06:24:13 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 08/07/2026 06:24:25 (UTC+00:00) Heure de l'Europe occidentale, GMT

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: anglais

Numéro de publication de l'avis: 474919-2026

Numéro de publication au JO S: 130/2026

Date de publication: 09/07/2026